

слоя небольшое и при облучении изменяется мало. Облучение границы раздела металл — легированный  $\text{As}_2\text{S}_3$  вызывает переход ионов из металла, ионы диффундируют через легированный слой к нелегированному полупроводнику. Облучение границы  $\text{As}_2\text{S}_3\text{Ag}_{2,4}$  —  $\text{As}_2\text{S}_3$  вызывает переход серебра из легированного слоя в нелегированный  $\text{As}_2\text{S}_3$ , убыль серебра вблизи этого перехода компенсируется диффузионным переносом от металлического слоя через легированный  $\text{As}_2\text{S}_3$ . Процесс фотолегирования в зависимости от параметров слоев и условий экспонирования можно реализовать, облучая как обе, так и одну из вышеуказанных границ. Этим и объясняется неоднозначность результатов выполненных ранее исследований.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Goldschmidt D., Bernstein T., Rudman P. S. The kinetics of photodissolution of silver in amorphous  $\text{As}_2\text{S}_3$  films // Phys. Stat. Sol. (a).— 1977.— 41, N 1.— P. 283.
2. Lakshmikumar S. T. A new model for photodiffusion of silver in amorphous chalcogenides // J. Non-Cryst. Sol.— 1986.— 88, N 2—3.— P. 196.
3. Matsuda A., Kikuchi M. Observations of photovoltage in Ag photodoping of amorphous  $\text{As}_2\text{S}_3$  films // Solid State Commun.— 1973.— 13, N 3.— P. 401.
4. Kluge G. A new interpretation of the photodoping effect in amorphous As — and Ge-chalcogenides // Phys. Stat. Sol. (a).— 1987.— 101, N 4.— P. 105.
5. Костышин М. Т., Романенко П. Ф., Красноженов Е. П. О применимости правила Урбаха для описания светочувствительности и поглощения света полупроводниками слоями с примесями и дефектами // ФТП.— 1968.— 2, № 8.
6. Janai M. Photodissolution of silver in amorphous  $\text{As}_2\text{S}_3$  films // Phys. Rev. Lett.— 1981.— 47, N 10.— P. 726.
7. Lis S. A., Lavine J. M. Ag photodoping of amorphous chalcogenides // Appl. Phys. Lett.— 1983.— 42, N 8.— P. 675.
8. Yokota J. On the theory of mixed conduction with special reference to the conduction in silver sulphide group semiconductors // J. Phys. Soc. of Jap.— 1961.— 16, N 11.— P. 2213.
9. Костышин М. Т., Касярум О. П., Кудрявцев А. А. Моделирование процесса фотолегирования в системе полупроводник — металл на основе представлений о ее трехслойной структуре // Укр. физ. журн.— 1987.— 32, № 7.
10. Owen A. E., Firth A. P. and Ewen P. J. S. Photo-induced structural and physicochemical changes in amorphous chalcogenide semiconductors // Phil. Mag. B.— 1985.— 52, N 3.— P. 347.

Поступила в редакцию 30 июня 1989 г.

УДК 621.383.8 : 621.3.049.774.2

С. А. МАЛЫШЕВ, Н. А. СВЯТКИНА, Ю. А. СМАНЦЕР,  
Б. С. ШЕВЦОВ  
(Минск)

#### ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖЭЛЕМЕНТНОГО ИНВЕРСИОННОГО СЛОЯ В ЛАВИННЫХ МДП-ФОТОПРИЕМНИКАХ

Использование МДП-структур, работающих в режиме лавинного умножения, для регистрации импульсного излучения обладает рядом достоинств: внутренним усилением до  $10^4$ , слабой зависимостью амплитуды выходного сигнала от питающего напряжения, возможностью реализации режима счета фотонов [1, 2]. Все это делает их перспективными для применения в системах обработки оптической информации. В то же время при лавинном умножении происходит инжеекция горячих носителей в диэлектрик, что является одной из причин деградации МДП-структур.

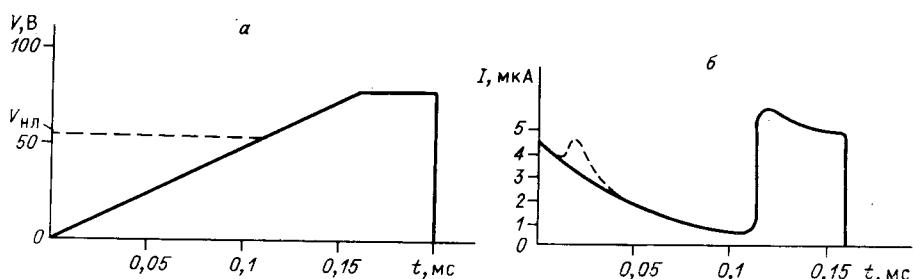


Рис. 1. Трапецидальный импульс напряжения питания (а) и соответствующая ему временная диаграмма тока смещения МДП-структуры (б)

тур, приводит к образованию в диэлектрике заряда и росту плотности быстрых поверхностных состояний на границе раздела диэлектрик — полупроводник [3].

Следует отметить, что при лавинной инжеекции горячих электронов в диэлектрик МДП-структуры встраивается отрицательный заряд [4]. Однако рядом авторов наблюдалось образование в диэлектрике и положительного заряда. Это происходило не только при лавинной инжеекции электронов, но и при облучении МДП-структур электронными пучками, что связывается с образованием ловушек в результате деструкции межатомных связей вблизи границы раздела диэлектрик — полупроводник [3, 5, 6].

При лавинной инжеекции неосновных носителей заряда в диэлектрик на характеристики МДП-структуры оказывает влияние краевой пробой [7]. Краевые эффекты другого рода в МДП-структуре сказываются в появлении электрической связи между инверсионными слоями под полевым электродом и окружающей его периферийной областью, что имеет место при значительном встроенному заряде соответствующего знака в диэлектрике вне полевого электрода [8].

В этой связи цель данной работы — изучение влияния краевого пробоя и образования в диэлектрике положительного заряда на электрофизические и фотоэлектрические характеристики расположенных рядом лавинных МДП-фотоприемников.

Исследуемые структуры изготовлены на основе кремния *p*-типа с концентрацией мелких акцепторов  $1,3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Диэлектрик толщиной 0,12 мкм получен термическим окислением подложек в сухом кислороде при температуре 1200 °C. Полевые электроды из алюминия или никеля формируются в виде круга либо в виде круга, помещенного внутри кольца. МДП-структуры с соответствующей конфигурацией электродов имеются в дальнейшем «круг» или «кольцо». Для осуществления режима лавинного умножения на полевой электрод подается импульсное трапецидальное напряжение [1] с крутизной фронта  $5 \cdot 10^5 \text{ В/с}$  (рис. 1, а). Временная диаграмма тока смещения представлена на рис. 1, б. Доза инжектированного заряда находится в пределах 0,04—2,0 Кл/см<sup>2</sup>. Исследуются вольт-фарадные релаксационные  $C - t$ -характеристики, сдвиг напряжения лавинообразования, а также изменения амплитуды фотосигнала в зависимости от величины инжектированного заряда.

Для проверки наличия краевого пробоя в рассматриваемых структурах проводится эксперимент, суть которого сводится к предварительной наработке в лавинном режиме МДП-структуры, полевой электрод которой выполнен в виде круга ( $\varnothing 330$  мкм). Затем с помощью процесса фотолитографии из «круга» ( $\varnothing 330$  мкм) формируется структура «круг» ( $\varnothing 195$  мкм) — «кольцо» ( $\varnothing 330$  и 230 мкм). Проведенные исследования  $C - V$ -характеристик отдельно полученных «круга» и «кольца» позволяют оценить вклад инжеекции горячих носителей в центральную и периферийную части МДП-структуры.

Как видно из рис. 2, инжеекция горячих носителей в диэлектрик МДП-структур (доза 0,04 Кл/см<sup>2</sup>) приводит к искажению вида  $C - V$ .

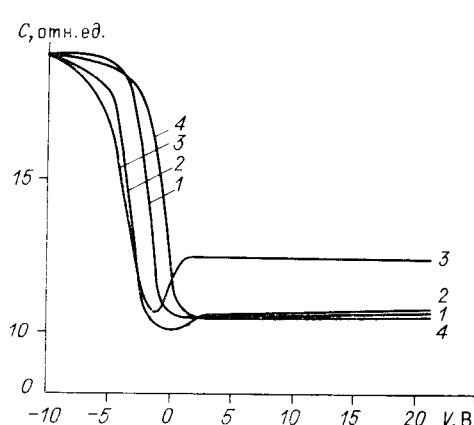


Рис. 2.  $C - V$ -характеристики:

1, 2 — круглого электрода до и после инжеекции электронов ( $\sim 0,04$  Кл/см $^2$ ); 3, 4 — соответственно «кольца» и «круга» после их формирования из круглого электрода (с инжеектированным зарядом  $\sim 0,04$  Кл/см $^2$ )

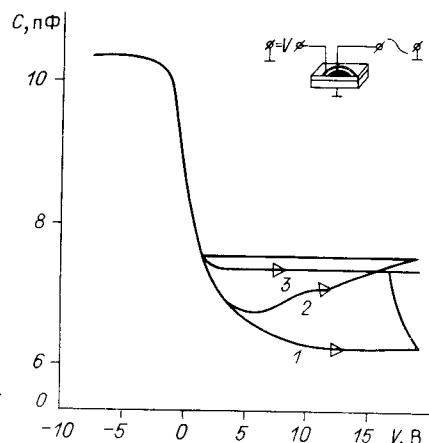


Рис. 3.  $C - V$ -характеристики «круга» в зависимости от напряжения на «кольце» для дозы инжеектированного в «кольцо» заряда  $0,1$  Кл/см $^2$ :

1 — неравновесная (прямой ход),  $\alpha' = 0,1$  В/с;  $V_K = -10$  В;  $\alpha' = 0,1$  В/с;  $V_K = +10$  В;  
2 — равновесная,  $\alpha' = 0,01$  В/с;  $V_K = 0$  В

характеристики периферийной части электрода (кривая 3), тогда как  $C - V$ -характеристика центральной части электрода остается практически без изменения (кривая 4).

Вольт-фарадная характеристика исходной МДП-структуре («круга») определяется при этом суперпозицией  $C - V$ -характеристик краевой и центральной частей полевого электрода и не дает правильного физического представления о механизме деградации МДП-структуры при лавинной инжеекции горячих носителей в диэлектрик. При дозе инжеектированного заряда более  $1,0$  Кл/см $^2$   $C - V$ -характеристика центральной части электрода также начинает искажаться, что указывает на перемещение области лавинного пробоя к центру электрода.

Влияние краевых эффектов на электрофизические и фотоэлектрические свойства соседних лавинных МДП-фотоприемников исследуется на структурах «круг»—«кольцо». В исходный диэлектрик МДП-структуре («кольцо») инжеектируется различная доза заряда и затем изучаются  $C - V$ -характеристики «круга» при постоянном напряжении смещения на «кольце».

При дозе инжеектированного заряда  $0,1$  Кл/см $^2$  наблюдается зависимость прямого хода неравновесной  $C - V$ -кривой «круга» от напряжения на «кольце» (рис. 3). Положительное смещение на «кольце» приводит к изменению неравновесной характеристики «круга», что свидетельствует о росте темнового тока. На временной диаграмме тока смещения «кольца» при этом появляется пик (см. рис. 1, б, штриховая линия), амплитуда которого уменьшается при возрастании частоты импульсов питания. Кроме того, амплитуда и положение пика в значительной степени зависят от величины постоянного смещения на «круге». Напряжение лавинообразования  $V_{hl}$  (см. рис. 1, а) на «кольце» возрастает на величину от единиц до десятков вольт при подаче постоянного положительного смещения на «круг» либо с уменьшением частоты повторения импульсов питания.

Таким образом, налицо возникновение межэлементной электрической связи в результате лавинной инжеекции в диэлектрик одного из элементов. Следует отметить, что при долговременном (до  $10^7$  циклов) воздействии на «круг» трапециoidalного напряжения питания меньше на несколько вольт, чем напряжение начала лавинообразования, заметной электрической связи между структурами «круг»—«кольцо» не наблюдается.

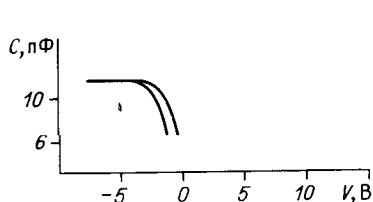


Рис. 4.  $C - V$ -характеристики «круга» до лавинной инжекции в «кольцо»,  $f = 1$  МГц (кривая 1) и для дозы инжектированного в «кольцо» заряда  $1 \text{ Кл}/\text{см}^2$  в зависимости от частоты измерительного сигнала: 2 —  $f = 100$  кГц; 3 —  $f = 1$ ; 4 —  $3,3$ ; 5 —  $10$  МГц

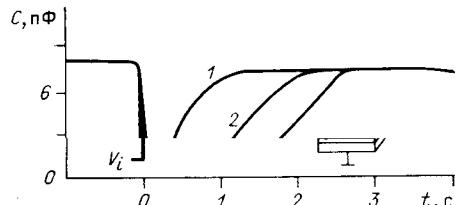


Рис. 5.  $C - t$ -характеристики «круга» при постоянном положительном смещении и импульсе напряжения на «кольцо» (В):

1 —  $V_{kp} = +20$ ;  $V_K$ :  $V_i = -10$ ;  $V_f = +20$ ;  
2 —  $V_{kp} = +5$ ;  $V_K$ :  $V_i = -10$ ;  $V_f = +40$ ;  
3 —  $V_{kp} = +20$ ;  $V_K$ :  $V_i = -10$ ;  $V_f = +40$

Появление пика на временной диаграмме тока смещения «кольца» сопровождается появлением подобного пика и при подаче импульса питания на «круг», хотя последний не подвергается лавинной инжекции. Рассматривая вольт-фарадные характеристики, напряжение лавинообразования, положение и величину пика тока смещения, можно отметить полную симметрию влияния режима работы одной МДП-структуры на другую.

При дозе инжектированного заряда (в «кольце») порядка  $1 \text{ Кл}/\text{см}^2$  величина пика на временной диаграмме тока смещения «кольца» возрастает.  $C - V$ -характеристика «круга» сдвигается в сторону отрицательных напряжений до нескольких вольт и искажается, хотя в данной структуре инжекция не проводилась. При этом появляется сильная частотная дисперсия вольт-фарадных характеристик «круга» (рис. 4). Дальнейший рост дозы инжектированного заряда сопровождается образованием в диэлектрике отрицательного заряда и ослаблением межэлементной электрической связи между исследуемыми МДП-структурами.

Рассматриваемые зависимости могут быть объяснены встраиванием в ходе инжекции горячих электронов в диэлектрик положительного заряда и его последующим диффузионно-полевым дрейфом из-под затвора МДП-структур в межэлектродные области.

Распространение положительного заряда уверенно наблюдается по сдвигу  $C - V$ -характеристик соседних МДП-структур, удаленных на несколько десятков микрометров. Под межэлектродным диэлектриком при этом образуется инверсионный слой, соединяющий области пространственного заряда (ОПЗ) соседних МДП-структур. Следует отметить, что излом прямого хода неравновесной  $C - V$ -характеристики при подаче положительного смещения на соседний электрод является первым признаком возникновения межэлементной электрической связи. Такой излом  $C - V$ -кривой обнаруживается на МДП-структуре с межэлектродным зазором, равным  $50 \text{ мкм}$ . Для отдельных образцов этот эффект проявляется при зазоре  $400 \text{ мкм}$ .

Излом прямого хода неравновесной  $C - V$ -характеристики (см. рис. 3, кривая 2) и появление пика на диаграмме тока смещения (см. рис. 1, б, штриховая линия) указывают на существование порогового потенциала, при достижении которого происходит перенос носителей заряда из-под «кольца» в ОПЗ «круга», что приводит к перекачке дополнительного заряда под «кольцо», вызывает сдвиг напряжения начала лавинообразования, величина которого сильно зависит от частоты импуль-

*Рис. 6. Зависимость напряжения фототоклика, работающего в лавинном режиме «кольца» при импульсном освещении «круга», от величины постоянного смещения на «круге»:  
1 — для исходной структуры; 2 — после прохождения дозы инжектированного заряда в  $0,16 \text{ Кл/см}^2$*

сов на «кольце» и постоянного смещения на «круге», определяющих величину поступающего дополнительного заряда.

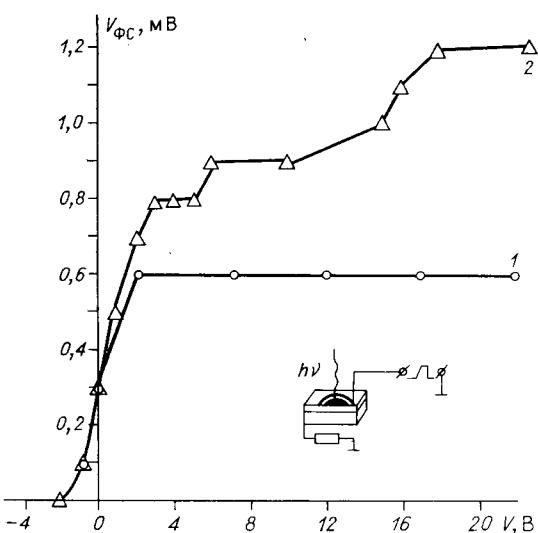
Наглядно процесс переноса заряда можно продемонстрировать, исследуя реакцию емкости «круга», находящегося под постоянным положительным смещением, на прямоугольный обедняющий импульс, по-данный на «кольцо» (рис. 5). В первоначальный момент времени, благодаря более высокому поверхностному потенциалу, в ОПЗ «кольца» переносится заряд из инверсионного слоя «круга», затем инверсионный слой «кольца» заполняется вплоть до выравнивания поверхностных потенциалов МДП-структур (см. рис. 5, кривая 2, участок а). Далее происходят самосогласованная релаксация емкости «круга» и «кольца» и обычная релаксация емкости «круга».

Рассмотрим влияние поверхностного проводящего канала на фотоэлектрические характеристики лавинных МДП-структур. На рис. 6 представлена зависимость величины фотосигнала, снимаемого с нагрузки работающего в лавинном режиме «кольца» при импульсном освещении «круга» ( $\lambda = 0,85 \text{ мкм}$ ,  $t_{\text{и}} = 0,2 \text{ мкс}$ ), от величины подаваемого на «круг» постоянного смещения. В исходном состоянии при отсутствии инжектированного в «круг» заряда фотоэлектрическая связь обусловлена диффузионной составляющей (см. рис. 6, кривая 1). При инжекции заряда в МДП-структуру ( $\sim 0,1 \text{ Кл/см}^2$ ) на нагрузке «кольца» появляется фотосигнал, обусловленный фотоэлектрической связью между двумя элементами. Его амплитуда увеличивается с увеличением дозы инжектированного в «круг» заряда и при его определенной величине достигает насыщения.

Таким образом, встраиваящийся в МДП-структуре при инжекции горячих электронов положительный заряд дрейфует на расстояние в несколько десятков микрометров от края электрода, и под межэлектродным диэлектриком образуется инверсионный слой. Наличие такого слоя ведет к изменению режима работы МДП-структуры за счет сдвига напряжения начала лавинообразования, вносит свой вклад в электрическую и фотоэлектрическую связь между элементами, что может заметно повлиять на фотоэлектрические характеристики многоэлементных лавинных МДП-фотоприемников.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гольбрайх Н. И., Шубин В. Э., Плотников А. Ф., Кравченко А. Б. Исследование лавинного процесса в МДП-структуре // Микроэлектроника.— 1979.— 8, № 11.
- Ветохин С. С., Гулаков И. Р., Залесский В. Б., Шуневич С. А. Исследование лавинных МДП-фотоприемников в режиме счета фотонов // ДАН БССР.— 1987.— 31, № 2.
- Sah C. T., Sun J., Tzou J. Generation-annealing kinetics of the interface donor states at 0.25 eV above the midgap and the turn-around phenomena on oxidized silicon during avalanche electron injection // J. Appl. Phys.— 1983.— 54, № 5.— P. 2547.
- Fischetti M. V., Gastaldi R., Maggioni F., Modelli A. Slow and fast states induced by hot electrons at Si—SiO<sub>2</sub> interface // J. Appl. Phys.— 1982.— 53, N 4.— P. 3136.



5. Sah C. T., Sun J., Tzou J. Generation-annealing kinetics and atomic models of a compensating donor in the surface space charge silicon // J. Appl. Phys.—1983.—53, N 2.—P. 944.
6. Fischetti M. V. The importance of the anode field in the controlling the generation rate of the donor states at the Si—SiO<sub>2</sub> interface // J. Appl. Phys.—1984.—56, N 2.—P. 575.
7. Залесский В. Л., Козлов С. Н., Невзоров А. Н., Потапов А. Ю. Влияние деградации при лавинном пробое на генерационную активность кремниевых МДП-структур // Электрон. техника. Сер. Полупроводниковые приборы.—1988.—Вып. 1(192).
8. Nicollian E. H., Goetzberger A. Lateral AC current flow model for metal-insulator-semiconductor capacitors // IEEE Trans. Electron Dev.—1965.—ED-12.—P. 108.

*Поступила в редакцию 2 января 1989 г.*

---